【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】平成17年9月22日(2005.9.22)

【公表番号】特表2003-505617(P2003-505617A)
【公表日】平成15年2月12日(2003.2.12)
【出願番号】特願2001-512972(P2001-512972)
【国際特許分類第７版】
　Ｄ０６Ｍ　11/30
　Ａ０１Ｎ　25/00
　Ａ０１Ｎ　59/08
　Ｄ０６Ｍ　11/54
　Ｄ０６Ｍ　13/352
【ＦＩ】
　Ｄ０６Ｍ　 9/08
　Ａ０１Ｎ　25/00　　１０２
　Ａ０１Ｎ　59/08　　Ａ
　Ｄ０６Ｍ　13/352

【手続補正書】
【提出日】平成16年1月9日(2004.1.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】有害な臭気および皮膚刺激効果の低い抗菌性を有するファブリックの製造方法
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハロアミン処理ファブリックの表面から残留遊離ハロゲンの実質量を除去して抗菌性を有するファブリックを製造する方法であって、
　アミン処理ファブリックを、ハロゲン含有液により洗浄し、次いで生成したハロアミン処理ファブリックを、約３～約１２のｐＨを有しかつ標準リンス液中で対象とする活性ハロゲンとの即時反応性を有する還元剤溶液により、約０～約７０℃の温度ですすぐ工程を含んでなり、
　該還元剤は、該ハロアミン内に結合された活性ハロゲン分子の認められる量を除去せず、それによりハロアミン処理ファブリックは抗菌性を維持できる方法。
【請求項２】
　該還元剤は、約０．１～約１００ｇ／ガロンの濃度で水溶液として存在する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　該還元剤は、約５～約９のｐＨを有し、約１～約１０ｇ／ガロンの濃度で水溶液として存在する請求項２に記載の方法。
【請求項４】

該還元剤は、約６～約８のｐＨを有する請求項２に記載の方法。
【請求項５】
該還元剤は、重亜硫酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム、水硫化ナトリウム、チオウレア、水素化ホウ素ナトリウム、亜硫酸ナトリウム、アスコルビン酸およびこれらの混合物からなる群から選択される請求項１に記載の方法。
【請求項６】
該還元剤は、重亜硫酸ナトリウムである請求項５に記載の方法。
【請求項７】
請求項１～６のいずれかに記載の方法により製造されたファブリック。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
（その解決方法）
そこで、本発明は、ハロアミン処理ファブリックの表面から残留遊離ハロゲンの実質量を除去して抗菌性を有するファブリックを製造する方法であって、
アミン処理ファブリックを、ハロゲン含有液により洗浄し、次いで生成したハロアミン処理ファブリックを、約３～約１２のｐＨを有しかつ標準リンス液中で対象とする活性ハロゲンとの即時反応性を有する還元剤溶液により、約０～約７０℃の温度ですすぐ工程を含んでなり、
該還元剤は、該ハロアミン内に結合された活性ハロゲン分子の認められる量を除去せず、それによりハロアミン処理ファブリックは抗菌性を維持できる方法
を提供する。